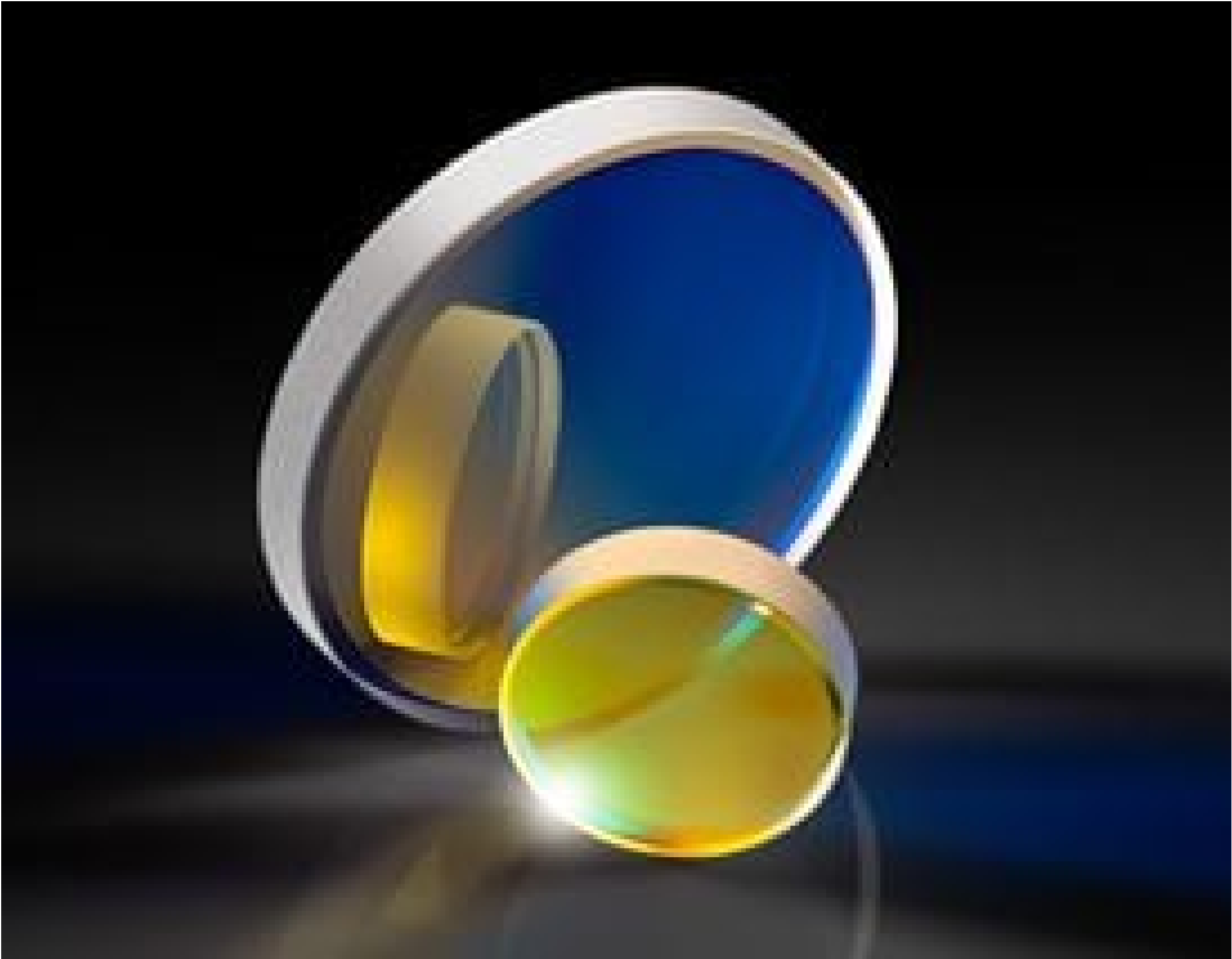


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm Dia., 3mm Thick, Fused Silica 755/632nm Alexandrite Mirror, 45 Deg AOI



Stock

#25-536

CONTACT

-

1

+

€183^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€183,00 prix unitaire
Qté 6-25	€146,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Alexandrite Laser Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.00/-0.10

Diamètre (mm):

90

Ouverture Utile (%):

<3	Parallélisme (arcmin):
3.00 ±0.10	Épaisseur (mm):
Fine Ground	Bords:
Propriétés optiques	
625 - 650, 755	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
45	Angle d'Incidence (°):
Laser Mrror (755nm)	Traitement:
Spécification du Traitement: R _{avg} > 90% @ 625 - 650nm @ 45° AOI At 755nm R _{sabs} ≥99.5% and R _{pabs} ≥99.5%, where R _s -R _p ≤0.5% @ 45° AOI	
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
10-5	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Réflectivité >99,5% à 755nm et réflectivité >90% à 625 – 650 nm
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
- Idéaux pour les applications dermatologiques

Les Miroirs Laser Alexandrite 755 nm TECHSPEC® offrent une réflectivité >99,5% à 755 nm pour une utilisation avec des lasers alexandrite à un angle d'incidence (AOI) de 0° ou 45°. Ces miroirs offrent également une réflectivité de >90% entre 625 et 650 nm pour les applications qui utilisent des faisceaux d'alignement. Ces miroirs présentent des substrats avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Les Mroirs Laser Alexandrite 755 nm TECHSPEC® sont idéaux pour une gamme d'applications dermatologiques telles que l'épilation, l'élimination des tatouages et le traitement des lésions vasculaires. La haute réflectivité combinée à un profil mince rend ces miroirs excellents pour les bras articulés médicaux qui nécessitent de multiples changements de direction par réflexion.